#### 12 октября

## 04.1

# Исследование параметров объемного газового разряда высокого давления при частоте следования импульсов до 100 kHz

© П.А. Бохан<sup>1</sup>, П.П. Гугин<sup>1</sup>, Д.Э. Закревский<sup>1,2</sup>, М.А. Лаврухин<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск, Россия <sup>2</sup>Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск, Россия E-mail: zakrdm@isp.nsc.ru

Поступило в Редакцию 15 мая 2024 г. В окончательной редакции 4 июня 2024 г. Принято к публикации 4 июня 2024 г.

Исследованы характеристики широкоапертурного объемного газового разряда в гелии в кювете объемом 60 cm<sup>3</sup> при давлении газа вплоть до атмосферного при возбуждении импульсами с фронтами нарастания напряжения менее 5 ns и частотой следования до 100 kHz в режиме цуга. При атмосферном давлении получен объемный характер протекания импульсного тока амплитудой до 50 A, пиковой мощностью до 2 MW и средней мощностью до 1.3 kW.

Ключевые слова: газовый разряд, высокое давление, гелий, импульсное возбуждение, высокая частота следования импульсов.

DOI: 10.61011/PJTF.2024.19.58648.19992

Настоящая работа направлена на развитие высокоэнергетических частотно-функционирующих электрофизических устройств высоковольтной техники нанои субнаносекундного диапазонов. Целью работы является исследование широкоапертурного импульсного газового разряда в гелии при давлении до 1 atm и частоте следования импульсов до 100 kHz. Подобные разряды — разряды высокого давления с объемным характером протекания тока в инертных и молекулярных газах — представляют интерес как способ энергетического воздействия на активные среды газовых лазеров; для диссоциации сложных газообразных химических соединений; в быстродействующих высоковольтных коммутаторах и источниках заряженных частиц; в импульсных источниках высокочастотных колебаний; в плазмохимических и плазмобиологических реакторах и т.д. (см., например, [1-3]). При этом актуальным требованием является возможность их функционирования с объемной стадией протекания разрядного тока при большой частоте следования импульсов (десятки-сотни kHz). Такие возможности открываются при инициировании разряда высоковольтными импульсами с длительностями импульса напряжения меньше времени прохождения разрядного промежутка ионизационной волной. Это накладывает требование на скорость нарастания  $(\sim kV/(cm\cdot ns))$  и длительность импульса напряжения (единицы-десятки ns).

Для исследования разряда использовалась кювета (рис. 1, *a*) с плоскими полированными электродами *1*, *1'* с диаметром открытой части 5.6 ст и межэлектродным расстоянием 2.4 ст (разрядный объем 60 ст<sup>3</sup>). Толщина ограниченно проводящих электродов из реакционно-спеченного карбида кремния (SiC) 8 mm, удельное сопротивление  $0.5-1 \Omega$ -ст. На наружной поверхности

электродов располагались медные контакты 2, на один из которых приклеивалась диэлектрическая пластина 3 из Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-керамики толщиной 2 mm. С другой стороны керамической пластины 3 присоединялся вспомогательный электрод-пластина из титана 4. В результате между пластинами 2 и 4 образовывалась емкость  $C_d \approx 70 \, \mathrm{pF.}$ Собственная емкость разрядной кюветы ~ 6 pF. Для возбуждения разряда напряжение можно было подавать в двух режимах: режим A — между электродами 4-1'(режим включения емкости С<sub>d</sub>, в этом случае предполагалось, что наличие С<sub>d</sub> будет ограничивать развитие искрообразования и позволит улучшить устойчивость разряда — обеспечить условия, при которых сохраняется объемный характер протекания тока); режим В непосредственно между электродами 1-1' (режим замкнутой емкости  $C_d$ ).

Импульсный источник питания состоял из транзисторного генератора с повышающим трансформатором, линии магнитного сжатия и коммутатора. Схема источника аналогична использованной в [4]. Для обеспечения быстрого нарастания напряжения на разрядном промежутке в качестве коммутатора использовался эптрон — разрядное устройство, функционирование которого основано на развитии тока при пробое капиллярной разрядной структуры с плазменным катодом [5]. Конструкция эптрона представлена на рис. 1, *b*. Эптрон состоит из цилиндрического катода из SiC с внутренним диаметром 28 mm и длиной 25 mm. С одной стороны катода устанавливалась капиллярная щелевая разрядная структура длиной 50 mm. Последняя представляла собой диэлектрический канал типа "меандр" с шагом 3 mm с сечением щели 0.3 × 15 mm. Геометрия щели ограничивала возможность генерации убегающих электронов с высокой энергией, достаточной для пролета по всей



**Рис. 1.** *а* — конструкция разрядной кюветы: *1*, *1'* — SiC-электроды, *2* — медные контакты, *3* — пластина Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, *4* — вспомогательный электрод. *b* — конструкция эптрона: *1* — SiC-катод, *2* — капиллярная разрядная структура, *3* — зона протекания тока, *4* — анод, *5* — дополнительный электрод.

длине капилляра от плазменного катода до анода, и в ней сохранялись условия для быстрой рекомбинации плазмы в межимпульсный период. Снаружи капиллярной структуры располагался заземленный металлический экран (на рис. 1, b не показан). С одного конца капиллярной структуры располагался анод. С другой стороны катода эптрона для облегчения развития тока устанавливался дополнительный электрод, позволяющий подавать поджигающий импульс.

Эксперименты проводились в режиме цуга импульсов с периодом 0.1 s и частотой заполнения регулярными импульсами f = 5-100 kHz. Длина цуга ~ 20 импульсов. Исследование динамики изменения параметров импульсов показало, что их параметры стабилизируются ко второму (третьему) импульсу и сохраняются на постоянном уровне до конца цуга. Все измерения проводились для последнего импульса в цуге.

В качестве рабочих сред эптрона использовались гелий и водород. Исследования показали, что меньшие времена коммутации ( $\sim 1 \text{ ns}$ ) достигаются в гелии. Однако более удобным оказалось водородное заполнение, так как в широком диапазоне частот следования импульсов время задержки развития разряда  $\tau_d$  (время от момента достижения 0.1 амплитуды напряжения на ячейке до момента начала роста тока) меняется слабо. Это позволяет работать в разнообразных условиях без перестройки звеньев магнитного сжатия в цепях первичного питания. На рис. 2 приведены функциональные параметры эптрона при рабочем давлении водорода  $p_{\rm H_2} = 1.1$  Torr при работе на активную нагрузку: зависимости времени задержки развития разряда  $au_d(f)$ , амплитуды тока  $I_e(f)$ и длительности переднего фронта (по уровню 0.1-0.9) импульса тока  $\tau_s(f)$  от частоты следования f при амплитуде импульса напряжения  $U = 17.5 \, \text{kV}$ . Поджигающий импульс с энергией до 0.1 J (разряд емкости  $C = 2 \,\mathrm{nF}$  при зарядном напряжении до 10 kV) мало влиял на характеристики эптрона до  $f \approx 70 \, \text{kHz}$ , но при больших частотах способствовал более стабильной работе устройства. Из рисунка видно, что при увели-



**Рис. 2.** Основные характеристики эптрона в зависимости от частоты следования импульсов:  $\tau_d(f)$ ,  $I_e(f)$  и  $\tau_s(f)$ . U = 17.5 kV,  $p_{H_2} = 1.1$  Torr.

чении f от 20 до 100 kHz время задержки развития разряда эптрона  $\tau_d$  уменьшается от 180 до 130 ns, амплитуда и длительность переднего фронта импульса тока меняются слабо ( $I_e \sim 140-120$  А и  $\tau_s = 3.5-2.7$  ns соответственно). Для давлений водорода  $p_{\rm H_2} \approx 2-4$  Torr при  $f \sim 5-60$  kHz характерны времена  $\tau_d \approx 100$  ns и менее с тенденцией значительного уменьшения  $\tau_d$  при увеличении напряжения и частоты следования импульсов, поэтому повышенные давления  $p_{\rm H_2} > 1.1$  Torr не использовались, несмотря на то что они приводили к уменьшению  $\tau_s \leq 2$  ns.

Инициирование разряда в кювете (рис. 1, *a*) осуществлялось при разряде рабочей емкости  $C_0 = 75 \text{ pF}$  через эптрон. Регистрировались импульсы напряжения *U* (напряжение на электродах I-I') и разрядного тока *I* (ток через шунт в цепи электрод 2-земля). Амплитуда импульсов напряжения на разрядном промежутке могла

меняться U = 2 - 24 kV, давление рабочего газа (гелия) до  $p_{\rm He} \approx 1$  atm.

При приложении напряжения к электродам в разрядном промежутке развивается ток, причем характер разряда зависит от режима подключения питания. Типичные осциллограммы напряжения U и тока разряда I приведены на рис. 3, *a* и *b*, например при  $p_{\rm He} \approx 50$  Torr и  $f = 65 \,\mathrm{kHz}$  (рис. 3, *a*, режимы *A*, *B*) и при  $p_{\mathrm{He}} \approx 450 \,\mathrm{Torr}$ и  $f = 95 \,\text{kHz}$  (рис. 3, b, режим A). Первый пик на осциллограмме тока является током зарядки собственной емкости разрядной кюветы. Характерные длительности фронта импульса напряжения по уровню 0.1-0.9 составляют  $\tau_U \approx 3-4$  ns (скорость нарастания напряжения до 5 kV/ns). Видно, что при подаче U на электроды 4-1'при включении емкости C<sub>d</sub> (режим A) напряжение на электроде 1 после прохождения импульса тока остается практически постоянным, так как разряд С<sub>d</sub> осуществлялся только через сопротивление датчика напряжения, а длительность тока определяется разрядом собственной емкости разрядного промежутка. Для получения устойчивого пробоя при увеличении p<sub>He</sub> напряжение на рабочей емкости  $C_0$  было необходимо повышать с U = 19 до 24 kV (предельное напряжение первичного генератора). Несмотря на это, разрядный ток уменьшался при слабо меняющейся длительности импульса  $\tau_I = 8-6$  ns. В этом режиме разряд устойчиво горит без искрообразования, по крайней мере вплоть до  $p_{\rm He} \approx 1$  atm. Фотографическая регистрация демонстрирует однородный характер свечения разряда.

При подаче U на электроды 1-1' при замкнутой емкости  $C_d$  (режим B) длительность импульса напряжения сокращается (~8 ns), длительность тока  $\tau_I \approx 10$  ns. В этом случае при тех же напряжениях достигается почти в 2 раза больший ток. Разряд горит без искрообразования до  $p_{\text{He}} \approx 300$  Torr, и при дальнейшем увеличении давления рабочего газа в разрядном промежутке наблюдаются множественные искровые каналы.

На рис. 3, с приведены зависимости от давления гелия  $p_{\rm He}$  тока через кювету  $I(p_{\rm He})$  и напряжения на ней  $U(p_{\text{He}})$  при f = 95 kHz для режимов A и B. В обоих случаях длительности импульсов тока не превышают времени прохождения ионизационного фронта через межэлектродное расстояние. Средняя скорость фронта ионизации в близких экспериментальных условиях  $\sim 10^8$  cm/s [4]. Сравнение достигаемых параметров разряда демонстрирует, что в режиме В, несмотря на ограничение длительности импульса напряжения до  $\sim 5-6\,\mathrm{ns}$  и ожидаемое улучшение устойчивости разряда, увеличения диапазона функционирования разряда не происходит. Режим А — режим с включенной емкостью C<sub>d</sub> — обеспечивает однородный объемный газовый разряд в большем диапазоне давлений, что, по-видимому, связано с ограничением амплитуды и длительности разрядного тока. В объемной стадии разряда в режиме А при  $p_{\text{He}} = 0.5 - 1$  atm достижимая амплитуда тока составила  $I \approx 100-50$  A с пиковой мощностью 1800-900 kW.



**Рис. 3.** a — осциллограммы напряжения U и тока I в режимах A и B при  $p_{\text{He}} = 50$  Torr, f = 65 kHz; b — осциллограммы напряжения U и тока I в режиме A при  $p_{\text{He}} = 450$  Torr, f = 95 kHz; c — зависимости от давления гелия  $p_{\text{He}}$  амплитудных значений напряжения U и тока I в режимах A и B, f = 95 kHz.

Таким образом, в настоящей работе были проведены исследования функционирования газового разряда в гелии при давлении вплоть до атмосферного при возбуждении высоковольтными (до  $\sim 24 \, \rm kV$ ) импульсами со скоростью нарастания до  $4-5 \, \rm kV/ns$  в цуге импульсов при частотах следования до  $f = 100 \, \rm kHz$ . При  $p_{\rm He} = 1 \, \rm atm$  получен объемный газовый разряд с импульсными токами до  $50 \, \rm A$  и средней мощностью до 1.3 kW. Результаты экспериментов показывают, что ограничение тока разряда позволяет обеспечить контролируемый и объемный характер протекания тока при атмосферном давлении гелия.

#### Финансирование работы

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда № 24-19-00037 (https://rscf.ru/project/24-19-00037/).

#### Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

### Список литературы

- T. Shao, Ch. Zhang, Pulsed discharge plasmas: characteristics and applications (Springer, 2023). DOI: 10.1007/978-981-99-1141-7
- [2] Y. Yin, H. Xu, Y. Zhu, J. Zhuang, R. Ma, D. Cui, Z. Jiao, Appl. Sci., 13, 12631 (2023). DOI: 10.3390/app132312631
- [3] K. Ollegott, P. Wirth, C. Oberste-Beulmann, P. Awakowicz, M. Muhler, Chem. Ing. Tech., 92, 1542 (2020).
  DOI: 10.1002/cite.202000075
- [4] P.A. Bokhan, P.P. Gugin, M.A. Lavrukhin, D.E. Zakrevsky, I.V. Schweigert, Phys. Plasmas, 30, 103506 (2023).
  DOI: 10.1063/5.0164607
- P.A. Bokhan, E.V. Belskaya, P.P. Gugin, M.A. Lavrukhin, D.E. Zakrevsky, I.V. Schweigert, Plasma Sources Sci. Technol., 29, 084001 (2020). DOI: 10.1088/1361-6595/ab9d91